

2026 年度シラバス

科目分類/Subject Categories			
学部等/Faculty	/工芸科学部/工芸科学部 : /School of Science and Technology/School of Science and Technology	今年度開講/Availability	/有/有 : /Available/Available
学域等/Field	/全学共通科目/全学共通科目 : /Program-wide Subjects/Program-wide Subjects	年次/Year	/3年次/3年次 : /3rd Year/3rd Year
課程等/Program	/高年次配当科目/人間教養科目(2023年度以前入学者) : /Liberal Arts for 3or4 years students/Liberal Arts(Course for students enrolled before 2023 academic year)	学期/Semester	/後学期/後学期 : /Second term/Second term
分類/Category	//工芸科学教養科目 : //Science and Technology Liberal Arts	曜日時限/Day & Period	/金2 : /Fri.2

科目情報/Course Information				
時間割番号 /Timetable Number	10125202			
科目番号 /Course Number	10160246			
単位数/Credits	2			
授業形態 /Course Type	講義 : Lecture			
クラス/Class				
授業科目名 /Course Title	ビジネスと知的財産活用 : Intellectual Property with Business			
担当教員名 / Instructor(s)	/(塩川 信明) : /SHIOKAWA Nobuaki			
その他/Other	インターンシップ実施 科目 /Internship	国際科学技術コース提供 科目 /IGP	PBL 実施科目 /Project Based Learning	DX 活用科目 /ICT Usage in Learning
			○	○
	実務経験のある教員による 科目 /Practical Teacher	○	本講義は製造系民間企業に所属する現役弁理士が担当する。/The lectures are given by active patent attorneys in the manufacturing private sector.	
科目ナンバリング /Numbering Code				

授業の目的・概要 /Objectives and Outline of the Course	
日	知的財産とビジネスの関係を理解し、社会活動に生かす手段を身につける ビジネスの各ステージで重要となる知的財産を特許を中心に解説し、活用方法について学ぶ。 本講義は製造系民間企業に所属する現役弁理士が担当する。
英	Understand the relationship between intellectual property and business and acquire the means to utilise it in social activities. Explain the intellectual property that is important at each stage of business, with a focus on patents, and learn how to utilise it. The lectures are given by active patent attorneys in the manufacturing private sector.

学習の到達目標 /Learning Objectives	
日	知的財産制度の概要を学び、実社会との関係を理解する。 ビジネスの基礎（類型、構造、ポイント等）を理解する。 知的財産をビジネスの各ステージで活用する方法を理解する。
英	Learn about the intellectual property system and understand its relationship to the real world. Understand the fundamentals of business (typology, structure, key points, etc.).

Understand how to utilise intellectual property at each stage of business.
--

学習目標の達成度の評価基準 / Fulfillment of Course Goals (JABEE 関連科目のみ)	
日	知的財産とビジネスの関係を説明でき、知的財産とによるビジネスの保護と発展について議論ができる。 ビジネスと知的財産の関係を説明でき、知的財産によるビジネスの保護と発展について説明できる。 ビジネスと知的財産の関係を説明できるが、知的財産によるビジネスの保護について説明できない。 ビジネスと知的財産それぞれの概要を理解できているが、これらの関係を説明できない。
英	To be able to explain the relationship between intellectual property and business, and discuss the protection and development of business through intellectual property. To be able to explain the relationship between business and intellectual property, and explain the protection and development of business through intellectual property. To be able to explain the relationship between business and intellectual property. Not to be able to explain how intellectual property protects business. Understand the overview of business and intellectual property. Not to be able to explain these relationships.

授業計画項目 / Course Plan			
No.		項目 Topics	内容 Content
1	日	イントロダクション	講師紹介、講義の目的・概要の説明
	英	Introduction	Introduction of lecturers, explanation of purpose and summary of lecture
2	日	ビジネス基礎	ビジネスデザインの基礎。知的財産の関与。
	英	Business Basic	Fundamentals of business design. Intellectual property involvement.
3	日	ビジネスの構造	類型、ビジネスモデルキャンパス
	英	Business structure	Typologies, business model campuses.
4	日	知的財産基礎	知的財産制度の比較。
	英	Intellectual property basics	Comparison of intellectual property systems.
5	日	特許	特許制度について
	英	Patent	Patent
6	日	情報としての特許	情報の種類と活用方法。
	英	Patents as information	Types and use of information.
7	日	意匠・商標・不正競争防止法	各制度の特性と得意分野
	英	Designs, trademarks and unfair competition prevention law	Characteristics and areas of expertise of each system.
8	日	ビジネスのポイント	顧客価値、マネタイズ、資金
	英	Key points of business	Customer value, monetisation, funding.
9	日	権利の特性と使用方法	マーケティングミックス、攻撃と防御
	英	Characteristics and use of rights	Marketing mix, attack and defence.
10	日	著作権	著作権とビジネス
	英	Copyright	Copyright business
11	日	企業価値とは	ブランド、CGC、デューデリジェンス
	英	Corporate value	Brands, CGC, Due Diligence
12	日	ビジネストピックスと知的財産	BCP/SDGs/ESG と知的財産
	英	Business topics and intellectual property	BCP/SDGs/ESG and intellectual property
13	日	ビジネスの保護 1	ケーススタディ
	英	Business protection 1	Case studies
14	日	ビジネスの保護 2	ケーススタディ
	英	Business protection 2	Case studies
15	日	知的財産の使い方	全体まとめ、関係職業・職種など
	英	How to manage intellectual property	Overall summary, relevant professions and occupations, etc.

履修条件 /Prerequisite(s)	
日	「知的財産経営論 a」または「知的財産経営論 b」、および「デザインとブランド」を履修していることが好ましい（必須ではない）。
英	It is preferable (but not required) to have taken "Intellectual Property Management Theory A" or "Intellectual Property Management Theory B" and "Design and Branding."

授業時間外学習（予習・復習等） /Required study time, Preparation and review	
日	<ul style="list-style-type: none"> ・本講義は復習が重要となるので、講義修了後に各自が振り返りを実施してください。 ・予習は、必要性も含めて、講義において指示します。
英	<ul style="list-style-type: none"> ・ As reviewing is important for this lecture, reflection should be practiced without fail after the lecture has been finished. ・ As for preparation, instructions including its necessity will be given during the lecture.

教科書／参考書 /Textbooks/Reference Books	
日	教科書は無し。参考書は講義において示します。
英	No textbooks will be used. Reference books will be specified in class.

成績評価の方法及び基準 /Grading Policy	
日	<p>出席およびレポートの提出が成績評価の前提となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 講義中に実施するワークショップ(40%) ・ 課題・レポート(60%) <p>により評価し,その合計点が 60 点以上を合格とします。</p>
英	<p>Attendance and the submission of coursework are prerequisites for receiving a grade.</p> <p>Assessment will be based on the following components:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Workshops conducted during class sessions (40%) ・ Assignments and reports (60%) <p>A total score of 60 or above is required to pass the module.</p>

留意事項等 /Point to consider	
日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 毎回ワークショップを実施します。 ・ ワークショップや講義内での課題実施に際し、Web を経由したサービスを活用します。二次元バーコードを読み取り可能、かつ、インターネットに接続可能な機器（PC やスマートフォンなど）を持参してください。 ・ 講義終了後、複数回のショートレポートを課します。
英	<ul style="list-style-type: none"> ・ Each class session will include a workshop. ・ Web-based services will be utilized for workshops and in-class assignments. Students must bring an internet-enabled device (e.g., a PC or smartphone) capable of scanning two-dimensional barcodes. ・ Multiple short reports will be required after the course.